

# 貸付機械器具一覧

【H31.3.1現在】

機器番号	機 器 名	料金 (円/時間)
M100	旋盤	540
M101	数値制御旋盤	2,050
M102	帯のこ盤	270
M103	小型平面研削盤	870
M104	細穴放電加工機	300
M105	マシニングセンター	2,040
M106	精密切断機	1,730
M107	シグ研削盤	2,050
M108	シグ中ぐりフライス盤	660
M109	NC放電加工機 (EA12E)	1,380
M110	炭酸ガスレーザ加工機	4,870
M111	雰囲気調整電気炉	1,750
M112	高周波誘導電気炉	1,300
M113	放電プラズマ焼結機	2,380
M114	高周波誘導式真空溶解炉	2,950
M115	粉末処理装置	140
M116	手動切断機	200
M117	試料埋込機	1,040
M118	自動研磨装置	3,150
M119	精密ワイヤ放電加工機 (B軸無使用)	2,550
M120	精密ワイヤ放電加工機 (B軸使用)	3,400
M121	高速加工機	3,000
M122	CAD/CAMシステム	680
M123	超高温電気炉	280
M124	真空含浸装置 (新)	680
M200	万能試験機	620
M201	精密万能試験機 (250kN)	1,150
M203	表面性測定機	660
M204	内部欠陥判定装置	460
M205	ワックス物性試験機	170
M206	塩乾湿複合サイクル試験機装置	1,690
M207	シャルピー衝撃試験機	240
M208	高温顕微硬度計	2,380
M209	薄膜硬度計	280
M210	摩擦磨耗試験機	1,320
M211	高解像度ハイスピードカメラ	1,370
M212	表面粗さ測定装置	1,720
M213	真円度測定機	1,100
M214	CNC三次元測定機	4,300
M215	万能形状測定装置	990
M216	サーモグラフィ	900
M217	レーザードップラー振動計システム	600
M218	F F Tアナライザ	220
M219	構造解析システム	1,670
M220	3次元湯流れ凝固解析システム	410
M221	マイクロスコブシステム	370
M222	測定顕微鏡	880
M223	万能投影机	370
M224	超微小硬さ試験機	530
M225	デジタル金属顕微鏡	600
M226	コンピュータ設計支援システム	490
M227	加工制御用CAD/CAMシステム	780
M228	マイクロフォーカスX線CT装置	3,950
M229	非接触3次元デジタイジングシステム	3,800
M230	表面性状測定機	2,540
M231	高倍率型マイクロスコブ	590
M232	卓上型走査電子顕微鏡 (新)	2,210

P100	サンプルカット用ブロック	410
P101	3Dプリンタ① (材料持込)	1,060
P102	3Dプリンタ② (0.1270mm)	1,690
P103	3Dプリンタ③ (0.1778mm)	2,170
P104	3Dプリンタ④ (0.2540mm)	2,690
P105	3Dプリンタ⑤ (0.3302mm)	3,270

機器番号	機 器 名	料金 (円/時間)
C100	射出成形機	1,560
C101	精密切断機(クリスタルカッター)	560
C102	精密切断機	910
C103	粉碎機(ジェットミル)	1,720
C104	マイクロカuttingマシン	530
C200	F T 赤外分光光度計	2,640
C201	X線回折装置	3,260
C203	床置型精密万能試験機	650
C204	卓上型精密万能試験機	250
C205	電界放出型走査電子顕微鏡 (分析)	6,860
C206	電界放出型走査電子顕微鏡 (観察)	5,750
C207	エネルギー分散型蛍光X線分析装置	1,290
C208	熱分析装置	2,030
C209	X線分析顕微鏡	2,070
C211	パウダテスター	250
C212	熱分解ガスクロマトグラフ質量分析装置	4,300
C213	レーザー回折式粒度分布測定器	1,480
C214	混練性・抽出性試験装置	3,750
C215	透過型電子顕微鏡	2,170
C216	比表面積・細孔分布測定装置	760
C217	X線光電子分光分析装置	4,400
C218	イオンクロマトグラフ (陽イオン)	910
C219	イオンクロマトグラフ (陰イオン)	910
C220	イオンビームミリング装置 (電子顕微鏡用試料作成装置)	2,050
C221	高周波プラズマ発光分析装置	3,400
C222	低温プラズマ分解装置	510
C223	マイクロサンプリングマシン	950
C224	ポロシメーター	4,550
C225	マイクロ波分解装置	850
C226	誘導結合プラズマ質量分析装置 (ICP-MS)	2,550
C227	紫外可視分光光度計	170
C228	恒温恒湿器 (旧)	150
C229	恒温恒湿器 (新)	160
C230	卓上型pHメーター	440
C231	実体顕微鏡システム	170

W100	丸鋸昇降盤	170
W101	軸傾斜横挽丸鋸盤	200
W102	手押し鉋盤	210
W103	自動鉋盤	360
W104	定温乾燥機	260
W105	ディスクリファイナー	1,220
W106	ホットプレス	390
W107	恒温恒湿器 (新)	140

J 100	電磁界解析ツール	710
J 104	微小部X線応力測定装置	710
J 105	三次元磁界ベクトル分布測定装置	160
J 106	真空均温熱処理装置	570
J 107	風量測定器 (新)	750
J 200	磁気シールドルーム (新)	11,260
J 201	ヘルムホルツコイル (新)	310
J 202	直流磁化測定装置 (新)	1,910
J 203	ソレノイドコイル (新)	480
J 204	校正用機器 (新)	150
J 205	ガウスメータ (新)	250

999	その他の機械器具	100
-----	----------	-----

機器番号	機 器 名	料金 (円/時間)
F101	低温恒温恒湿機	320
F102	クリーンベンチ	200
F103	真空凍結乾燥機	1,370
F104	ドラム乾燥機	830
F105	真空包装機	180
F106	低温高速遠心機	330
F107	ブレハブ仕込室	180
F108	高温高圧調理殺菌装置	1,740
F109	ブレハブ貯蔵室	180
F111	細胞破碎装置	210
F112	微生物増殖装置	490
F114	多機能型超高速遠心機	2,910
F117	スプレードライヤー	280
F118	高圧ホモジナイザー	350
F119	微細装置	580
F121	ホモジナイザー	160
F122	ロータリーエバポレーター	130
F200	水分活性測定装置	470
F201	測色色差計	380
F203	レオメーター	210
F204	生物電子顕微鏡	1,490
F205	落射蛍光顕微鏡	450
F206	近赤外分析装置	1,840
F207	高速液体クロマトグラフ	1,290
F208	キャピラリーガスクロマトグラフ	660
F210	酵母・細菌同定システム	530
F211	自記光電分光光度計	460
F212	原子吸光分析装置	890
F213	pHメーター	200
F214	密度比重計	140
F215	蛍光プレートリーダー	1,110
F216	高速液体クロマトグラフ質量分析計	6,070
F217	マイクロファイバースコープ	870

E100	スパッタリング装置	1,920
E101	マニュアルブローバ	270
E102	マスクアライナー	660
E103	スピコーター	200
E104	真空熱処理装置	830
E200	高精度12bit型ミックスド・シグナル・オシロスコープ	260
E201	2GHz帯デジタル・オシロスコープ	260
E202	ホトマスク撮影カメラ	110
E203	走査型プローブ顕微鏡	1,420
E204	分光光度計 (電子材料分光特性評価装置)	570
E205	ソースコード静的解析ツール	330
E206	微細形状観察評価装置 (レーザー顕微鏡)	1,950
E207	制御技術開発用モデルベース設計ツール	880
E208	スペクトラム・アナライザ (U3751)	150
E209	ネットワーク・アナライザ	580
E300	電波暗室 (新)	5,030
E301	雑音電界強度測定器 (新)	1,780
E302	雑音端子電圧測定器 (新)	1690
E303	雑音電力測定器 (新)	1,640
E304	ハンドヘルドスペクトラライザ (新)	230
E305	放射イミュニティ試験器 (新)	2,170
E306	伝導イミュニティ試験器 (新)	1,280
E307	静電気試験器 (新)	300
E308	商用磁界試験器 (新)	440
E309	アンテナ計測システム (新)	1,190
E310	オシロスコープ (新)	300
E400	ドローンテスト用ネット (新)	1,200